Si calcoli il tempo libero medio di un elettrone che ha una mobilità di 1000 cm²/Vs a 300 K; si calcoli anche il cammino libero medio, cioè la distanza percorsa da un elettrone tra due urti successivi. Si assuma per questi calcoli m_n = 0,26m₀

$$\mu_{n} = \frac{q \tau_{c}}{m_{n}^{*}} \quad \text{Formula 2.3} \implies \tau_{c} = \frac{\mu_{n} m_{n}^{*}}{q}$$

$$(1000 \times 10^{-4}) \times (0.26 \times 0.91 \times 10^{-30})$$

Appendice D Costanti fisiche

| Mobilità in $\left[\frac{m^2}{V \cdot s}\right]$ | |
|--|---------------------------|
| $\ell = v_{th}\tau_c$ $v_{th} = 10^7 \text{ cm/s}$ $= 1.5 \times 10^{-13} \times 10^7 = 1.5 \times 10^7$ | |
| $=1.3\times10 \times10 =1.3\times$ | $10 m = 1.5 \mu\text{m}$ |

2 Per un semiconduttore con un rapporto tra le mobilità b ≡ μ_n/μ_p > 1 costante e indipendente dalla concentrazione delle impurità, si trovi la massima resistività ρ_m in funzione della resistività intrinseca ρ_i e del rapporto tra le mobilità. Di che tipo è il semiconduttore?

$$\rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} = \frac{1}{q\mu_p(bn + p)}$$

$$\rho_i = \frac{1}{qn_i(\mu_n + \mu_p)} = \frac{1}{qn_i(\mu_n + \mu_p)} = \frac{1}{qn_i(\mu_p(b+1))}$$

$$\rho = \rho_i \frac{n_i(b+1)}{bn+p} = \rho_i \frac{n_i(b+1)}{bn+p} = \rho_i \frac{n_i(b+1)}{b\frac{n_i^2}{p} + p}$$

$$\rho_{MAX} \Rightarrow b \frac{n_i^2}{p} + p = min$$

$$\frac{d}{dp} \left(b \frac{n_i^2}{p} + p \right) = 0 \Rightarrow -b \frac{n_i^2}{p^2} + 1 = 0$$

Essendo
$$\sqrt{b}>1$$
 , è p ad essere maggiore della concentrazione intrinseca. Il semiconduttore è di tipo p.

 $p = \sqrt{bn_i}$

3 In un campione di semiconduttore omogeneo di tipo n sono iniettate in un punto delle lacune minoritarie. Al semiconduttore sia applicato un

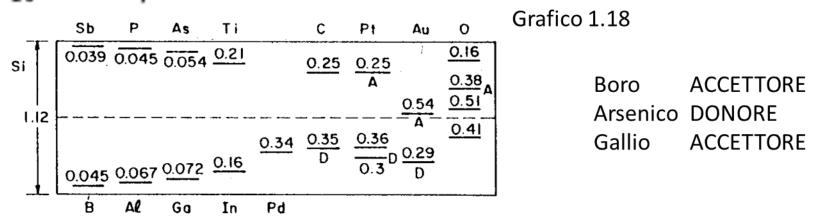
campo elettrico di 50 V/cm che in 100 μ s sposta i portatori minoritari per una distanza di 1 cm. Si calcoli la velocità di trascinamento e la diffusività dei portatori minoritari.

$$v_p = \frac{1cm}{100\mu s} = \frac{1cm}{100 \times 10^{-6} s} = 10^4 \text{ cm/s}$$

$$v_p = \mu_p E \qquad \mu_p = \frac{v_p}{E} = \frac{10^4 \text{ cm/s}}{50 \text{ V/cm}} = 200 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$$

$$D_p = \frac{kT}{a} \mu_p = 0.0259V \times 200 \, cm^2 / (V \cdot s) = 5.2 \, cm^2 / s$$

4 Si determinino per gli elettroni e per le lacune le concentrazioni, le mobilità e le resistività in un campione di silicio a 300 K per ciascuna delle seguenti concentrazioni di impurità: (a) boro con 5 10¹⁵ atomi/cm³; (b) boro con 2 10¹⁶ atomi/cm³ e arsenico con 1,5 10¹⁶ atomi/cm³; (c) boro con 5 10¹⁵ atomi/cm³, arsenico con 10¹⁷ atomi/cm³ e gallio con 10¹⁷ atomi/cm³.

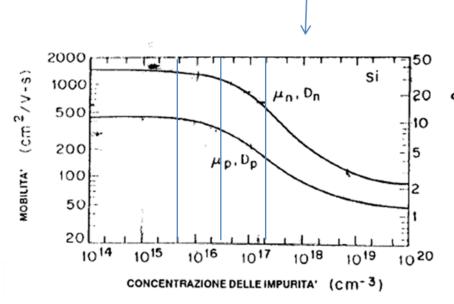


| | N _A (cm ⁻³) | N _D (cm ⁻³) | N _A -N _D (cm ⁻³) | tipo | $N_B = N_A + N_D (cm^{-3})$ |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|--|------|-----------------------------|
| Caso a | 5x10 ¹⁵ | 0 | 5x10 ¹⁵ | р | 5x10 ¹⁵ |
| Caso b | 2x10 ¹⁶ | 1.5x10 ¹⁶ | 5x10 ¹⁵ | р | 3.5x10 ¹⁶ |
| Caso c | 5x10 ¹⁵ +10 ¹⁷ | 10 ¹⁷ | 5x10 ¹⁵ | р | 2.05x10 ¹⁷ |

| | N _A (cm ⁻³) | N _D (cm ⁻³) | N_A - N_D (cm ⁻³) | tipo | $N_B = N_A + N_D (cm^{-3})$ |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|
| Caso a | 5x10 ¹⁵ | 0 | 5x10 ¹⁵ | р | 5x10 ¹⁵ |
| Caso b | 2x10 ¹⁶ | 1.5x10 ¹⁶ | 5x10 ¹⁵ | р | 3.5x10 ¹⁶ |
| Caso c | 5x10 ¹⁵ +10 ¹⁷ | 10 ¹⁷ | 5x10 ¹⁵ | р | 2.05x10 ¹⁷ |

$$\begin{cases} p = 5 \times 10^{15} \\ n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{\left(1.45 \times 10^{10}\right)^2}{5 \times 10^{15}} = 4.2 \times 10^4 \end{cases}$$

$$\rho = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)} \approx \frac{1}{qp\mu_p}$$



$$\begin{split} \mu_{pa} &= 350 \, cm^2 / V \cdot s & \rho_a &= 3.6 \Omega cm \\ \mu_{pb} &= 300 \, cm^2 / V \cdot s & \rho_b &= 4.2 \Omega cm \\ \mu_{pc} &= 200 \, cm^2 / V \cdot s & \rho_c &= 6.3 \Omega cm \end{split}$$

Uno strumento con sonda a quattro punte, con spaziatura tra le sonde di 0,5 mm, viene usato per misurare la resistività di un pezzo di silicio di tipo p. Si determini la resistività del pezzo di semiconduttore se il suo diametro è 100 mm e lo spessore è 50 µm. La corrente ha un'intensità di 1 mA e la differenza di potenziale misurata tra le due sonde più interne è di 10 mV. Se il campione venisse tagliato in piccole piastrine quadrate di 5 mm di lato, quanto sarebbe stata la tensione misurata per una corrente costante di 1 mA?

Fig.2.6. Metodo delle 4 punte. Formula 2.16

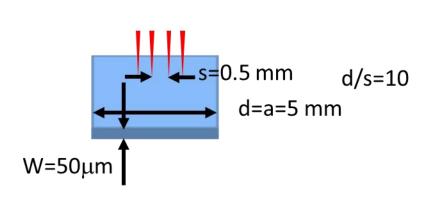
$$\rho = \frac{V}{I}W \cdot CF \Omega \cdot cm$$
Nel limite tra le sonde, il fattore di correzione vale

 $d \gg s$, dove $s \ge 1$ a spaziatura tra le sonde, il fattore di correzione vale $\pi/\ln 2 = 4.54$.

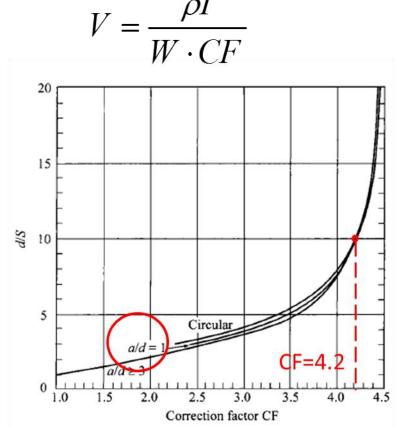
$$\rho = \frac{10mV}{1mA} 50\mu m \cdot 4.54 = 0.23 \,\Omega \cdot cm$$

Uno strumento con sonda a quattro punte, con spaziatura tra le sonde di 0.5 mm, viene usato per misurare la resistività di un pezzo di silicio di tipo p. Si determini la resistività del pezzo di semiconduttore se il suo diametro è 100 mm e lo spessore è $50 \mu \text{m}$. La corrente ha un'intensità di 1 mA e la differenza di potenziale misurata tra le due sonde più interne è di 10 mV. Se il campione venisse tagliato in piccole piastrine quadrate di 5 mm di lato, quanto sarebbe stata la tensione misurata per una corrente costante di 1 mA?

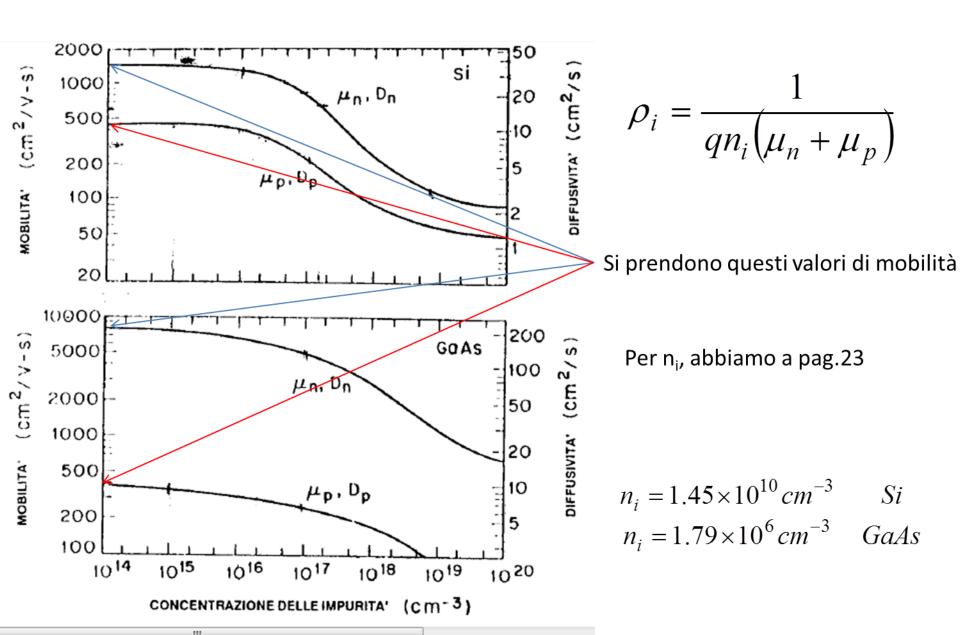
Fig.2.6. Metodo delle 4 punte. Formula 2.16



$$V = \frac{\rho I}{W \cdot CF} = \frac{0.22 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-4} \times 4.2} = 0.010V = 10mV$$



Determinare le resistività del Si intrinseco e del GaAs intrinseco alla temperatura di 300 K.



7 Sia dato un pezzo di silicio con drogaggio incognito. Eseguite tutte le misure si ottengono le seguenti informazioni con riferimento ai simboli della Figura 2.8: W = 0,05 cm, A = 1,6 10⁻³ cm², I = 2,5 mA e il campo magnetico è di 30 nT (si ricordi che 1 T = 10⁴ Wb/cm²). Se si misura una tensione di Hall di +10 mV, si desidera conoscere il coefficiente di Hall, il tipo di conducibilità, la concentrazione dei portatori maggioritari, la resistività e la mobilità del campione di semiconduttore.

$$\frac{1}{qp} = -\frac{A}{W} \frac{V_H}{I_p B_z}$$

Noi possiamo calcolare la velocità dei portatori maggioritari

$$v_{px} = \mu_p E = \frac{J_p}{qp} = \frac{I_p}{Aqp}$$

Per calcolare la resistività, però, occorre la mobilità. Questa può essere ottenuta dal grafico di pag.40 nella ipotesi che vi sia un solo tipo di droganti 8 Un pezzo di semiconduttore di tipo n ha un drogaggio di arsenico di 2 10¹⁶ atomi/cm³, una densità di centri di ricombinazione nel corpo del materiale di 2 1015 atomi/cm2 e una concentrazione di centri di ricombinazione superficiale di 1010 centri/cm3. (a) Trovare all'interno del corpo del semiconduttore il tempo di vita dei portatori minoritari, la lunghezza di diffusione e la velocità di ricombinazione superficiale in condizioni di basso livello di iniezione. I valori di σ_p e σ_s sono rispettivamente 5 10^{-15} cm² e 2 10^{-16} cm². (b) Se il campione è illuminato con una luce che viene assorbita uniformemente e crea 1017 coppie elettrone-lacuna/cm2s, quanto vale la concentrazione delle lacune alla superficie?

Questa è una incongruenza dimensionale.

E' evidente che abbiamo
$$N_t = 2 \times 10^{15} \quad atomi/cm^3$$

$$N_{st} = 10^{10} \quad centri/cm^2$$

Inoltre, NON avendo altri dati, assumiamo trappole profonde, ossia

$$E_t \approx E_i$$

Ricordiamo anche che siamo in **DEBOLE INIEZIONE**

8 Un pezzo di semiconduttore di tipo n ha un drogaggio di arsenico di 2 10¹⁶ atomi/cm³, una densità di centri di ricombinazione nel corpo del materiale di 2 1015 atomi/cm2 e una concentrazione di centri di ricombinazione superficiale di 1010 centri/cm3. (a) Trovare all'interno del corpo del semiconduttore il tempo di vita dei portatori minoritari, la lunghezza di diffusione e la velocità di ricombinazione superficiale in condizioni di basso livello di iniezione. I valori di σ_p e σ_s sono rispettivamente 5 10^{-15} cm² e 2 10^{-16} cm². (b) Se il campione è illuminato con una luce che viene assorbita uniformemente e crea 1017 coppie elettrone-lacuna/cm2s, quanto vale la concentrazione delle lacune alla superficie?

$$\tau_{p} = \frac{1}{v_{th}\sigma_{p}N_{t}} \qquad S_{lr} = v_{th}\sigma_{p}N_{st}$$

$$N_{D} = 2 \times 10^{16} cm^{-3} \qquad D_{p} \approx 10 cm^{2}/s$$

$$L_{p} = \sqrt{D_{p}\tau_{p}}$$

$$p_{n}(x) = p_{n0} + \tau_{p}G_{L}\left(1 - \frac{\tau_{p}S_{lr}}{L_{p} + \tau_{p}S_{lr}}e^{-\frac{x}{L_{p}}}\right) \qquad p_{n}(0) = p_{n0} + \tau_{p}G_{L}\left(1 - \frac{\tau_{p}S_{lr}}{L_{p} + \tau_{p}S_{lr}}\right)$$

9 Su di una superficie laterale di una stretta striscia di silicio di tipo n lunga W vengono iniettati portatori minoritari; questi vengono poi estratti dalla superficie opposta dove $p_n(W) = p_{no}$. Nella regione 0 < x < W non vi è campo elettrico. Si ricavi l'espressione delle densità di corrente sulle due superfici. Sapendo che il tempo di vita dei portatori è 50 μ s e che W = 0,1 mm, si calcoli la frazione di corrente iniettata che raggiunge per diffusione la superficie opposta. Sia $D = 50 \text{ cm}^2/\text{s}$.

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} = \sqrt{50 \times 50 \times 10^{-6}} = 5 \times 10^{-4} \, cm = 5 \, \mu m$$

$$J_{p}(x) = q \frac{D_{p}}{L_{p}} [p_{n}(0) - p_{n0}] \frac{\cosh\left(\frac{W - x}{L_{p}}\right)}{\sinh\left(\frac{W}{L_{p}}\right)} \qquad \frac{J_{p}(W)}{J_{p}(0)} = \frac{1}{\cosh\left(\frac{W}{L_{p}}\right)} = \text{a voi il calcolo}$$

$$\frac{J_p(W)}{J_p(0)} = \frac{1}{\cosh\left(\frac{W}{L_p}\right)} = \text{a voi il calcolo}$$

10 In un esperimento di Haynes-Schockley i massimi valori dei portatori minoritari per t₁ = 100 μs e per t₂ = 200 μs differiscono di un fattore 5. Si calcoli il tempo di vita dei portatori minoritari.

$$p_n(x, t) = \frac{N}{\sqrt{4\pi D_p t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4D_p t} - \frac{t}{\tau_p}\right) + p_{no}$$
 (2.93).

$$p_{\max}(t) - p_{n0} = \frac{N}{\sqrt{4\pi D_p t}} \exp\left(-\frac{t}{\tau_p}\right)$$

$$\frac{p_{\max}(t_1) - p_{n0} = \frac{N}{\sqrt{4\pi D_p t_1}} \exp\left(-\frac{t_1}{\tau_p}\right)}{p_{\max}(t_2) - p_{n0} = \frac{N}{\sqrt{4\pi D_p t_2}} \exp\left(-\frac{t_2}{\tau_p}\right)} = \sqrt{\frac{t_2}{t_1}} \exp\left(\frac{t_2 - t_1}{\tau_p}\right)$$

$$5 = \sqrt{2} \exp\left(\frac{100 \times 10^{-6}}{\tau_p}\right)$$